

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第3部門第4区分  
 【発行日】平成23年8月18日(2011.8.18)

【公開番号】特開2008-202099(P2008-202099A)  
 【公開日】平成20年9月4日(2008.9.4)  
 【年通号数】公開・登録公報2008-035  
 【出願番号】特願2007-40032(P2007-40032)  
 【国際特許分類】

C 2 1 D 9/32 (2006.01)  
 C 2 1 D 1/10 (2006.01)  
 H 0 5 B 6/10 (2006.01)  
 H 0 5 B 6/06 (2006.01)

【F I】

C 2 1 D 9/32 B  
 C 2 1 D 1/10 P  
 H 0 5 B 6/10 3 3 1  
 H 0 5 B 6/06 3 9 1

【手続補正書】  
 【提出日】平成23年6月30日(2011.6.30)

【手続補正1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】請求項5  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【請求項5】

前記接触子を前記被加工物に接触させて前記距離センサにより熱膨張変位を検出し、該熱膨張変位に応じて、前記誘導加熱コイル支持移動手段が、前記誘導加熱コイルを上記被加工物から離隔する方向に移動するように構成されていることを特徴とする、請求項1に記載の高周波熱処理装置。

【手続補正2】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】0020  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【0020】

好ましくは、接触子を被加工物に接触させて距離センサにより熱膨張変位を検出し、検出した熱膨張変位に応じて、上記誘導加熱コイル支持移動手段は、誘導加熱コイルを被加工物から離隔する方向に移動するように構成されている。

上記構成によれば、熱膨張変位測定手段により熱膨張変位を検出し、この熱膨張変位に応じて、誘導加熱コイルを被加工物から離隔する方向に随時移動しながら高周波誘導加熱を行うことができる。したがって、誘導加熱コイルと被加工物との接触を防止することができる。